

Министерство образования Российской Федерации
Омский государственный университет

**Фотолитографический метод создания
тонкопленочных ВТСП структур**

Лабораторный практикум
(для студентов физического факультета)
специальность 010400 «Физика»

УДК 538.945
Ф81

*Рекомендован к изданию учебно-методическим советом ОмГУ.
Протокол № 1 от 28 апреля 2004 г.*

Ф81 Фотолитографический метод создания тонкопленочных ВТСП структур: Лабораторный практикум (для студентов физического факультета) / Сост.: С.А. Сычев, Г.М. Серопян, И.С. Позыгун, В.В. Семочкин. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. – 27 с.

Материал соответствует Государственному образовательному стандарту по специальности 010400 «Физика». Даются представления о фотолитографическом методе создания тонкопленочных структур с использованием метода сухого травления и, в частности, микроструктур из тонких ВТСП пленок для изготовления элементов сверхпроводящей криоэлектроники.

Может быть использован студентами других специальностей.

УДК 538.945

Издание
ОмГУ

Омск
2004

© Омский госуниверситет, 2004

Учебно-практическое издание

Составители

С.А. Сычев, Г.М. Серолян, И.С. Позыгун, В.В. Семочкин

ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ВТСП СТРУКТУР

Лабораторный практикум
(для студентов физического факультета)
специальность 010400 «Физика»

Технический редактор *М.В. Быкова*

Редактор *Л.Ф. Платоненко*

Подписано в печать 21.05.04. Формат бумаги 60x84 1/16.
Печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 50 экз. Заказ 314.

*Издательско-полиграфический отдел ОмГУ
644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а, госуниверситет*